



(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 86109661.8

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: B 01 J 19/12

(22) Anmeldetag: 15.07.86

F 21 V 7/22, B 41 M 7/00  
B 41 F 23/04

Ein Antrag gemäss Regel 88 EPÜ auf Berichtigung der Beschreibung und Ansprüche liegt vor. Über diesen Antrag wird im Laufe des Verfahrens von der Prüfungsabteilung eine Entscheidung getroffen werden.

(30) Priorität: 20.07.85 DE 3526082

(71) Anmelder: Ferd. Rüesch AG.  
Spitalgasse 8  
CH-9004 St. Gallen(CH)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
20.05.87 Patentblatt 87/21

(71) Anmelder: Leybold-Heraeus GmbH  
Bonner Strasse 498 Postfach 5107 60  
D-5000 Köln 51(DE)

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 27.04.88

(72) Erfinder: Born, Reinhard  
Röhnstrasse 4  
D-6454 Bruchköbel(DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(72) Erfinder: Lotz, Hans-Georg, Dr.  
Huehnerberg 9a,  
D-6466 Gründau 2(DE)

(72) Erfinder: Keller, Heinz  
Hafnerwaldstrasse 20 c  
CH-9012 St. Gallen(CH)

(72) Erfinder: Lehner, Martin  
Jahnstrasse 4  
CH-9000 St. Gallen(CH)

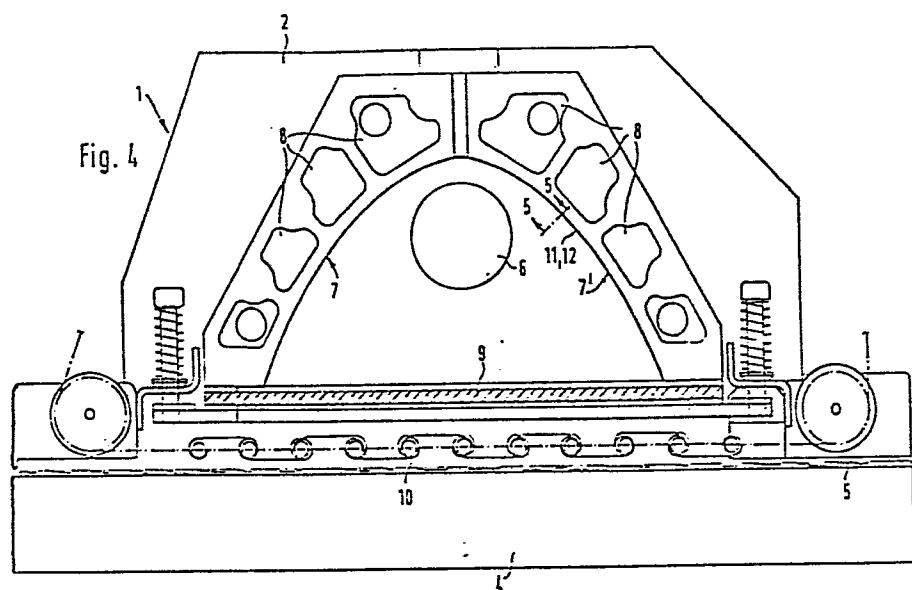
(74) Vertreter: Federhen, Ludwig, Dr.  
Kronprinzstrasse 14  
D-7000 Stuttgart 1(DE)

(54) Vorrichtung zur Behandlung von Materie durch UV-Strahlen.

(57) Die Vorrichtung (1) besteht aus einer UV-Strahlenquelle (6) und einem Reflektor (7,7'). Der Reflektor besteht vorzugsweise aus zwei parabolischen oder elliptischen Halbschalen (7,7'). Auf der Reflektorfläche sind eine oder mehrere Beschichtungen zur Reflexion (12) der UV-Strahlung und eine darunter liegende Beschichtung zur Absorption (11) des längerwelligen Teils des Spektrums der UV-Strahlenquelle angeordnet. Zwischen diesen Beschichtungen ist eine Diffusionssperrsicht angeordnet. Die Reflexionsschicht (12) besteht aus abwechselnd niedrigbrechenden dielektrischen Schichten aus SiO<sub>2</sub> und hochbrechenden Schichten aus HfO<sub>2</sub>, die Diffusionssperrsicht aus einer dielektrischen Schicht mit einer physikalischen Dicke von mindestens 0,5 μ aus SiO<sub>2</sub> und die Absorptionsschicht (11) aus einer schwarzen El-oxierung, Schwarzverchromung oder - vernickelung, Anodisierung oder Brünierung einer polierten Kupfer- oder Nickelbeschichtung des aus Aluminiumlegierung bestehenden Reflektorkörpers.

EP 0 222 060 A3

./...





EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X	US-A-4 048 490 (H.H. TROUE) * Zusammenfassung; Figuren; Spalte 1, Zeile 63 - Spalte 2, Zeile 65 *	1,21	B 01 J 19/12 F 21 V 7/22 B 41 M 7/00 B 41 F 23/04
Y	---	2-4,14, 16-18	
X	US-A-4 563 589 (H.D. SCHEFFER) * Zusammenfassung; Figur 1; Spalte 3, Zeile 7 - Spalte 4, Zeile 56 *	1,2,21	
X	US-A-3 644 730 (J.C. OGLE Jr. et al.) * Zusammenfassung; Figuren 1-6; Spalte 2, Zeile 33 - Spalte 3, Zeile 13; Spalte 3, Zeile 26 - Spalte 4, Zeile 45 *	1,6	
A	---	7	
X,P	DE-A-3 529 800 (B. GLAUS) * Zusammenfassung; Ansprüche 1-3,5,6; Seite 6, Zeile 16 - Seite 7, Zeile 8; Figur 1 *	1,21	
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 208 (C-130)[1086], 20. Oktober 1982; & JP-A-57 117 339 (MITSUBISHI RAYON K.K.) 21-07-1982 * Zusammenfassung *	16,17	B 01 J B 41 M B 41 F F 21 V
Y	US-A-3 819 929 (H.C. NEWMAN) * Zusammenfassung; Figuren 6,6a,11,14; Spalte 1, Zeilen 28-45; Spalte 5, Zeile 37 - Spalte 6, Zeile 3; Spalte 7, Zeilen 38-64 *	2-4,14, 18	
	-----		

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt

Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prufer
DEN HAAG	26-01-1988	VAN IDDEKINGE R.E.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument
A : technologischer Hintergrund		L : aus andern Gründen angeführtes Dokument
O : nichtschriftliche Offenbarung		.....
P : Zwischenliteratur		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument